

機器利用技術講習会のご案内

【フォトマスク作製装置】 レーザ描画装置

地方独立法人大阪府立産業技術総合研究所では、所有している試験研究機器等を用いて、中小企業の皆様の新技术・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用頂くため、下記の要領で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

◆日 時：平成26年10月1日（水） 9：30～12：15

*当日、「高精度フォトリソグラフィ(13:15～16:00)」の機器利用技術講習会も行っております。この機器利用技術講習会では、当講習会で作製したフォトマスクを使って、Si基板上に塗布したフォトレジストを露光機により、露光・現像してパターンニングします。装置の理解をより深めるためにも「高精度フォトリソグラフィ」の機器利用技術講習会を当講習会とあわせて受講されることを強く推奨いたします。

◆場 所：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 (和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。

◆定 員：5名(1社1名まで)

※ 受講票は発行いたしません。

※ 受講には TRI カードが必要です。まだお持ちでない方は当日お申し込みいただけます(無料)。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 顧客サービス室 顧客サービス課

※ お申し込みはメール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2509) までお願いします。

メールでお申し込みを頂いた方のみ、返信にて受付をお知らせします。

なお、メールでお申し込みを頂いた方には、当研究所の関連情報をご案内する「産技研ダイレクトメールニュース」を配信させていただきますので、ご了承下さい。

◆対象機器：フォトマスク作製装置 (レーザ描画装置)

フォトマスクは、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)微細加工や半導体加工技術において大切なフォトリソグラフィに欠かせないものです。当研究所では、自所内でフォトマスクを作製することにより MEMS デバイス、フォトリソグラフィ関連技術等の迅速な研究開発が可能となっています。

本講習では、フォトマスクを設計・作製してフォトリソグラフィによる微細加工を行いたい方を対象に、フォトマスク設計のコツ、フォトマスク作製装置の簡単な解説を聴講していただいた後、実際にフォトマスクを作製していただきます。このことにより、フォトマスクの設計・作製についての理解を深めることを目的とします。



機器型番：DWL-66FS

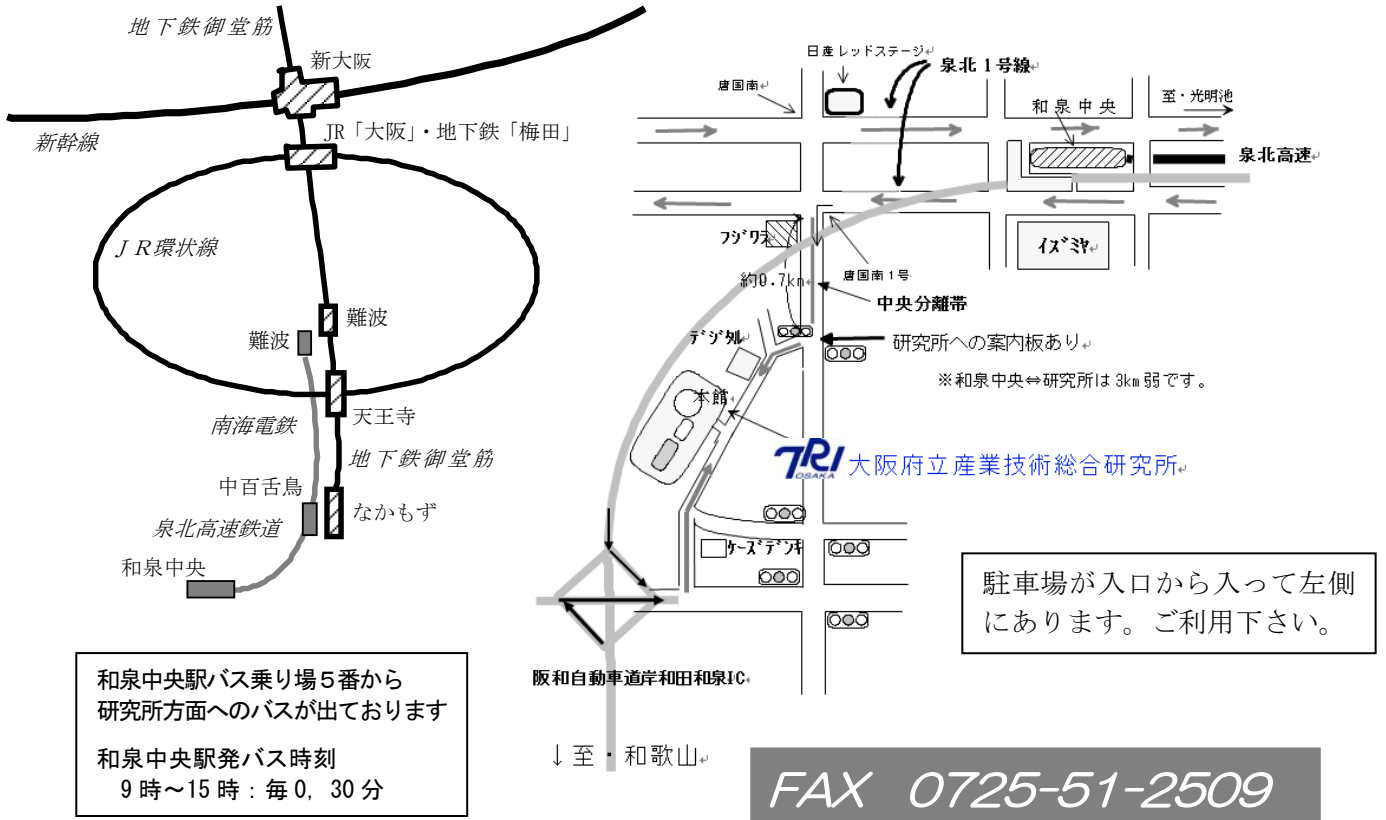
株式会社 日本レーザー

◆講習担当：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所

制御・電子材料科 村上修一、宇野真由美、佐藤和郎、中山健吾

・お問い合わせ先：顧客サービス課 (TEL：0725-51-2518)

大阪府立産業技術総合研究所交通案内図(略図)



機器利用技術講習会申込書 テーマ「フォトマスク作製装置（レーザー描画装置）」

開催日：平成26年10月1日（水）

会 社 名	
所 在 地	(〒)
参 加 者	所属： 役職： 氏名：
	TRIカードをお持ちの方は、「K番号」のご記入をお願いします。(K)
連 絡 先	TEL： FAX：
講習会の情報源	①産技HP ②産技メール配信 ③講習会チラシ ④他機関の情報 ⑤その他()

講習会の案内など、当研究所の関連情報をお知らせする「産技研ダイレクトメールニュース」の配信をご希望の方は、下記にメールアドレスをご記入下さい。

--	--

※上記参加申込書に記載された内容につきましては、本講習会の参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。

- ①お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート。
- ②当研究所および関連団体の催事情報提供などの案内